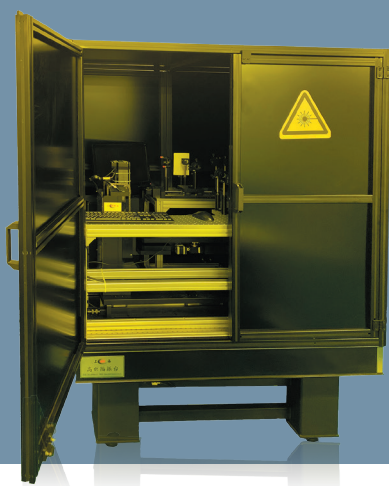


高精度电光晶体定向仪

High Precision Electro-optic Crystal Orientator

CrysEO400-CI



主要技术与性能指标

- 锥光干涉条纹图分辨率：2048×2048
- Z 轴偏离角测量精度：优于 0.200 mrad
- 可测量的样品尺寸：≤ 400 mm×400 mm、厚度 10—20 mm

主要应用

广泛应用于电光晶体非接触定向和高精度切割制造等

代表性应用成果

● 发明专利

刘世杰, 鲁棋, 周游, 等. 电光晶体通光面法线与晶体光轴的夹角测量装置和方法: 中国, ZL201710917302.9. 2019-05-17.

● 发表论文

Lu Qi, Wang Shenghao, Zhou You, et al. High-precision determination of the cut angle of an electro-optic crystal by conoscopic interference. Applied Optics, 2018, 57(24): 6886-6891.
基于锥光干涉测量原理, 创新性提出了基于泰曼 - 格林干涉原理的高精度光路装调方法、重心连线拟合找中心法和四点拟合圆分析偏离角法等, 解决了电光晶体 Z 轴切割误差不能被传统定向仪高精度且非接触测量等问题

主要用户单位	中国科学院强激光材料重点实验室、中国工程物理研究院、山东大学、中国科学院福建物质结构研究所等
研制单位	中国科学院上海光学精密机械研究所
联系方式	刘世杰 021-59962310, 13701930842 shijieliu@siom.ac.cn